

2021 年

- 2021-J1(W) 【招待講演】
IEDM2020 を振り返って
先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集) (電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会／応用物理学会シリコンテクノロジー分科会), (2021), 2021 年 1 月 28 日, オンライン
黒田 理人
- 2021-J2(W) 【招待講演】
A High SNR Wide Spectral Response CMOS Image Sensor Technology for Smart Sensing
4th International Symposium on Devices, Circuits and Systems, (2021), 2021 年 3 月 3 日, オンライン
Rihito Kuroda
- 2021-J3(W) 【招待講演】
軟 X 線検出 CMOS イメージセンサ sxCMOS の開発
ISSP Workshop 2021 先端軟 X 線科学への基幹技術 (東京物性研究所), (2021), 2021 年 3 月 4 日, オンライン
須川成利
- 2021-J4(W) Si(551)および(111)表面の構造解析
日本表面真空学会東北・北海道支部学術講演会講演予稿集, P-06, 2021 年 3 月 4 日
青山大晃, 内藤完, 中塚聡平, 小川修一, 虻川匡司, 江口豊明, 服部賢, 服部梓, 黒田理人
- 2021-J5(W) 高密度容量を用いたアナログ相関多重サンプリングによる CMOS イメージセンサのノイズ低減
映像情報メディア学会技術報告・情報センシング研究会 (一般社団法人 映像情報メディア学会), (2021), Vol.45, No.11, pp.13-16.
鴨志田 俊太, 鈴木 学, 黒田 理人, 須川 成利
- 2021-J6(W) 45 μ m 厚裏面照射型フォトダイオード・2 段 LOFIC を有する広ダイナミックレンジ軟 X 線検出グローバルシャッタ CMOS イメージセンサ
映像情報メディア学会技術報告・情報センシング研究会 (一般社団法人 映像情報メディア学会), (2021), Vol.45, No.11, pp.17-20.
四家 寛也, 黒田 理人, 小林 諒太, 村田 真麻, 藤原 康行, 鈴木 学, 原田 将真, 柴口 拓, 栗山 尚也, 初井 宇記, 宮脇 淳, 原田 哲男, 山崎 裕一, 渡邊 健夫, 原田 慈久, 須川 成利
- 2021-J7(W) 【招待講演】
A Global Shutter Wide Dynamic Range Soft X-ray CMOS Image Sensor with BSI Pinned Photodiode, Two-stage LOFIC and Voltage Domain Memory Bank
次世代画像ビジョンシステム部会定例会 (第 191 回), (2021), 2021 年 4 月 28 日, オンライン
黒田理人
- 2021-J8(W) 【招待講演】
小さな気泡の不思議な世界 ～マイクロバブル, ナノバブルの基礎と工学的な応用の可能性について～
京大微細気泡研究会(RISH セミナー), 京都大学生存圏研究所, 2021 年 5 月 25 日, オンライン
高橋正好
- 2021-J9(W) 【招待講演】
小さな気泡の不思議な世界 ～マイクロバブル, ナノバブルの基礎と応用～
精密加工研究会 第 107 回例会, 2021 年 5 月 28 日, オンライン
高橋正好

- 2021-J10(W) 【招待講演】
Effect of dilute sulfuric acid on photoresist removal by ozone microbubbles
第 38 回 国際フォトポリマーコンファレンス(ICPST-38), B2-04, 2021 年 6 月 16 日, オンライン
高橋正好, 堀邊英夫, 田寺克己, 宮崎紳介, 白井泰雪, 須川成利
- 2021-J11(W) 【記念講演】
イソプロピルアルコールを用いた金属銅及び酸化銅上の表面改質
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), Vol. 121, No.71, SDM2021-22, pp.1-6, 2021 年 6 月 22 日, オンライン
間脇 武蔵, 寺本 章伸, 石井 勝利, 志波 良信, 諏訪 智之, 東雲 秀司, 清水 亮, 梅澤 好太, 黒田 理人, 白井 泰雪, 須川 成利
- 2021-J12(W) 【招待講演】
成膜工程と連動した基板表面処理と表面イニシヤライズ
CVD 反応分科会第 34 回シンポジウム(公益社団法人化学工学会), 2021 年 8 月 4 日, オンライン
諏訪 智之
- 2021-J13(W) ミニマルファブ用ミラー磁場閉じ込めプラズマ CVD 装置によるジクロロシランガスを用いたシリコン窒化膜形成
第 82 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会), 12a-N323-6, 2021 年 9 月 12 日, オンライン
後藤 哲也, 小林 誠二, タイ クオック クオン, 藪田 勇氣, 須川 成利, 原 史朗
- 2021-J14(W) 深層学習を用いた低温ポリシリコン薄膜トランジスタの電気的特性推定
第 82 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会), 10p-N302-4, 2021 年 9 月 12 日, オンライン
倉重 貴行, 永野 貴寛, 水谷 彬, 片山 慶太, 中村 大輔, 後藤 哲也, 池上 浩
- 2021-J15(W) 電流計測プラットフォームを応用した SiN 膜中トラップ放電電流の統計的計測
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), (2021), Vol. 121, No.212, SDM2021-51 (2021-10), pp.23-26, 2021 年 10 月 21 日, オンライン
齊藤 宏河, 鈴木 勇人, 朴 賢雨, 黒田 理人, 寺本 章伸, 諏訪 智之, 須川 成利
<https://www.ieice.org/ken/paper/20211021HC5X/>
- 2021-J16(W) トランジスタ構造・動作領域・キャリア走行方向による RTN 挙動の統計的解析
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), (2021), Vol. 121, No.212, SDM2021-52, pp.27-32 2021 年 10 月 21 日, オンライン
秋元 瞭, 黒田 理人, 間脇 武蔵, 須川 成利
<https://www.ieice.org/ken/paper/20211021NC5z/>
- 2021-J17(W) 大判 12 μ m 画素と高解像度 2.8 μ m 画素の高精度近接容量 CMOS イメージセンサ
映像情報メディア学会技術報告・情報センシング研究会(一般社団法人 映像情報メディア学会), (2021), Vol. 45, No.30, IST2021-51, pp.13-16, 2021 年 9 月 21 日, オンライン
須釜 侑希, 渡部 吉祥, 黒田 理人, 山本 将大, 後藤 哲也, 安田 俊朗, 村上 真一, 羽森 寛, 栗山 尚也, 須川 成利
<https://www.ite.or.jp/ken/paper/20211021GAju/>
- 2021-J18(W) 流体濃度分布その場計測へ向けた 1000 fps 高 SNR グローバルシャッタ CMOS イメージセンサ
映像情報メディア学会技術報告・情報センシング研究会(一般社団法人 映像情報メディア学会), (2021), Vol. 45, No.30, IST2021-52, pp.17-20, 2021 年 10 月 21 日, オンライン
及川哲 黒田理人 高橋圭吾 志波良信 藤原康行 四家寛也 村田真麻 郭家祺
<https://www.ite.or.jp/ken/paper/20211021OAjt/>

2021-J19(M) CMOS イメージセンサの感度・飽和・撮影速度・分光感度性能の追求
映像情報メディア学会誌(一般社団法人 映像情報メディア学会), (2021), Vol.75, No.6,
pp.729-733, 2021 年 11 月 1 日
須川 成利, 黒田 理人